06;07

Визуальное наблюдение частотной перестройки диодного лазера на основе мод шепчущей галереи при комнатной температуре

© А.Н. Именков, В.В. Шерстнев, М.А. Сиповская, Е.А. Гребенщикова, А.М. Монахов, G. Boissier, R. Teissier, А.Н. Баранов, Ю.П. Яковлев

Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия Institut d'Electronique du Sud (IES), Université Montpellier 2, CNRS, IES (UMR CNRS 5214), 34095 Montpellier, France E-mail: v.sherstnev@mail.ioffe.ru

Поступило в Редакцию 23 июля 2009 г.

Осуществлено прямое наблюдение увеличения длины волны излучения полудискового диодного WGM-лазера в процессе импульса питающего тока. Исследована частотная перестройка WGM-лазера ($2.35\,\mu$ m) с секторным резонатором. Обнаружено, что в процессе протекания импульса тока длительностью до $1.5\,\mu$ s наблюдается плавная перестройка длины волны излучения основной моды в длинноволновую сторону на 30 Å при комнатной температуре.

PACS: 85.30.z, 42.79.-e, 42.55.Px

В последние годы интенсивно развиваются исследования по созданию WGM-лазеров, генерирующих излучение в средней ИК-области спектра (2–4 μ m) на основе мод шепчущей галереи (whispering gallery mode, сокращенно — WGM) [1–4]. Такие лазеры привлекательны большой добротностью резонатора и низкими значениями порогового тока по сравнению с полосковыми лазерами.

Одной из главных проблем дисковых WGM-лазеров, препятствующих их активному использованию, является вывод излучения за пределы дискового резонатора. Создание дискового резонатора с усеченным резонатором [3] позволило эффективно решать эту задачу.

52

В работе (5) впервые обнаружена частотная перестройка инфракрасного диодного WGM-лазера с дисковым резонатором. Это открывает возможность использовать такие лазеры в диодной лазерной спектроскопии для создания портативных газоанализаторов. О наличии частотной перестройки свидетельствовало увеличение длины волны излучения в конце импульса тока питающего лазер при увеличении длительности импульса. Однако характер изменения длины волны в процессе импульса оставался предположительным. Данная работа является продолжением работы [5] по изучению механизма перестройки частоты WGM-лазер.

Цель настоящей работы — прямое наблюдение увеличения длины волны излучения и исследование характера изменения длины волны в процессе протекания тока через полудисковый диодный WGM-лазер.

Для решения поставленной задачи была выращена структура методом молекулярно-пучковой эпитаксии на установке RIBER Compact 21E на подложке GaSb (100) *n*-типа. Активная область общей толщиной 850 nm состояла из двух напряженных квантовых ям состава Ga_{0.65}In_{0.35}As_{0.11}Sb_{0.89}, каждая толщиной 10 nm, разъединенных слоем 30 nm состава Al_{0.25}Ga_{0.75}As_{0.02}Sb_{0.98}. Волноводные слои, изготовленные из Al_{0.25}Ga_{0.75}As_{0.02}Sb_{0.98}, имели толщину по 400 nm. Активная область преднамеренно не легировалась. Волновод был ограничен широкозонными слоями p(Be)- и n(Te)-Al_{0.9}Ga_{0.1}As_{0.08}Sb_{0.92} толщинами по 1.0 μ m. С внешней стороны широкозонных слоев были выращены два тонких по 100 nm варизонных слоя AlGaAsSb для улучшения инжекции носителей заряда в активную область. Верхний контактный слой GaSb *p*-типа имел толщину 475 nm и был легирован до концентрации дырок 5 × 10¹⁸ cm⁻³. Более подробно процесс выращивания лазерной структуры описан в [6].

Из созданных структур изготавливались лазерные чипы с резонатором в форме диска диаметром 200 µm и высотой 15 µm методом фотолитографии и химического травления.

Омические контакты к полупроводниковой гетероструктуре создавались методом термического вакуумного напыления с взрывной фотолитографией. Для этого на верхний эпитаксиальный слой *p*-GaSb наносили последовательно металлы и сплав: Cr–Au:Zn–Au. Верхний контакт лазерного чипа представлял собой кольцо шириной 30μ m с внешним диаметром 180μ m, который отстоял от края резонатора на 10μ m. Со стороны подложки также методом термического вакуумного напыления наносился сплошной многослойный Cr–Au:Te–Au контакт.

После напыления структура подвергалась термообработке в среде водорода для сплавления металлических слоев. Из полученных чипов методом раскалывания изготавливались симметричные лазерные чипы с резонаторами в форме полудиска. Кристалл напаивался на корпус типа TO-18 с помощью индия, который, в свою очередь, вставлялся в корпус параболического отражателя. Параболический отражатель служил для сбора и фокусировки спонтанного и лазерного излучения на щель монохроматора.

Была собрана и измерена серия лазеров с резонатором в форме полудиска, все они имели диодные характеристики с напряжением отсечки $\sim 0.6\,\mathrm{V}$ при комнатной температуре и дифференциальным сопротивлением порядка 0.8-1.0 Ω. Для изучения модовой структуры спектров лазеров использовался двухрешеточный спектрометр марки ДФС-32 с неохлаждаемым фоторезистором PbS в качестве фотодетектора. Спектры снимались с разрешением 2 Å. Спектры электролюминесценции WGM-лазеров изучались в импульсном режиме. Длительность импульса менялась от 0.1 до 1.5 µs, скважность составляла 33. Через лазеры пропускался ток величиной от 0.1 до 0.7 А. Измерения проводились при комнатной температуре. Пороговый ток составлял 240 mA, как и в работе [5]. В режиме генерации наблюдались те же лазерные моды. На плато импульса питающего тока преобладала спектральная полоса, имеющая длину волны $\lambda = 2.3534 \,\mu m$ и ширину на половине высоты 2 Å при коротких импульсах тока ($\sim 0.2 \,\mu s$). При увеличении длительности импульса тока эта полоса расширялась в длинноволновую сторону тем сильнее, чем больше ток. Ее ширина достигала 30 Å при длительности импульса 1.5 µs и амплитуде 0.7 А.

Для непосредственного прямого наблюдения изменения длина волны в процессе импульса тока была собрана измерительная установка, схема оптической части которой приведена на рис. 1. Полудисковый WGM-лазер (1) помещен в фокус параболического рефлектора, обеспечивающего сбор практически всего излучения. Параллельный поток этого излучения проходит через эталонный резонатор Фабри–Перро (2), представляющий собой плоскопараллельную пластину полуизолирующего Si толщиной 1 mm. Интервал между резонансными длинами волн пластины составляет 7.5 Å для исследуемого лазера.

Далее поток излучения фокусируется линзой (3) на быстродействующий фотодиод (4) на основе четверных соединений GaInAsSb [7].



Рис. 1. Схема оптической установки для наблюдения изменения длины волны диодного полудискового WGM-лазера в процессе питающего его импульса тока.

Продетектированный фотодиодом сигнал фиксируется цифровым осциллографом GDS-820C. Осциллограммы прошедшего через внешний резонатор Фабри–Перро излучения полудискового WGM-лазера и питающего лазер тока показаны на рис. 2. В спонтанном режиме импульс излучения повторяет импульс тока. В лазерном режиме импульс излучения промодулирован синусоидой и интенсивность излучения слегка уменьшается в процессе импульса. В отсутствие внешнего резонатора синусоидальная модуляция исчезает, а падение интенсивности излучения в процессе импульса остается. Падение интенсивности излучения в процессе импульса остается. Падение интенсивности излучения в процессе импульса остается изменение длины волны объясняется нагреванием активной области лазера. Синусоидальная модуляция импульса излучения объясняется изменением длины волны основной моды лазера на несколько межмодовых интервалов внешнего резонатора, а именно на 4 интервала по 7.5 Å на рис. 2, т.е. на 30 Å. Направление изменения длины волны определялось с помощью поворота внешнего резонатора, как и в работе [8].

Поворот внешнего резонатора при котором нормаль к его плоскости отклоняется от оптической оси установки смещает синусоиду влево на экране осциллографа, т.е. показывает увеличение длины волны в процессе импульса тока. При увеличении тока синусоида также смещается влево из-за увеличения длины волны основной моды лазерного излучения.

Рис. З иллюстрирует изменения длины волны лазерной моды в процессе протекания токовых импульсов различной амплитуды, определенной по временам, соответствующим экстремумам синусоиды на осциллограммах лазерного излучения. Учитывалось, что период синусоиды составляет 7.5 Å. Видно, что длина волны увеличивается в



Рис. 2. Осциллограммы импульсов излучения, прошедшего через резонатор Фабри–Перро (курсор 1) диодного полудискового WGM-лазера и питающего его тока (курсор 2) в спонтанном режиме (230 mA): *a* — в лазерном режиме (620 mA), *b* — при длительности импульса тока 1.5 µs.



Рис. 3. Увеличение длины волны лазерной моды диодного полудискового WGM-лазера в процессе протекания импульсов питающего тока различной амплитуды. Длительность импульсов 1.5 µs, скважность около 34. Температура лазера 300 К.

процессе импульса и тем сильнее, чем больше амплитуда импульса тока, и ее изменение достигает 30 Å при токе — 700 mA за время $1.5 \,\mu$ s. Увеличение длины волны во времени сублинейное, т. к. оно обусловлено нагреванием активной области лазера.

Таким образом, осуществлено прямое наблюдение плавной перестройки длины волны излучения полудискового диодного WGM-лазера в процессе импульса питающего тока. Установлен характер этого увеличения, обусловленного нагреванием активной области лазера в процессе протекания импульса тока длительностью до $1.5 \,\mu$ s. Зарегистрирована плавная перестройка длины волны излучения основной моды в длинноволновую сторону на 30 Å при комнатной температуре.

Работа частично поддержана грантами РФФИ 07-02-92170-НЦНИ_а и 08-02-90039-Бел_а и программой президиума РАН № 27 "Основы фундаментальных исследований нанотехнологий и наноматериалов".

Список литературы

- Sherstnev V.V., Krier A., Monakov A.M., Hill G. // Electron. Lett. 2003. V. 39. P. 916–918.
- [2] Шерстнев В.В., Монахов А.М., Астахова А.П., Кислякова А.Ю., Яковлев Ю.П., Аверкиев Н.С., Krier А., Hill G. // Физика и техника полупроводников. 2005. Т. 39. В. 9. С. 1087–1092.
- [3] Monakhov A.M., Sherstnev V.V., Astakhova A.P., Yakovlev Yu.P., Boissier G., Reissier R., Baranov A.N. // Appl. Phys. Lett. 2009. V. 94. P. 051102.
- [4] Averkiev N.S., Sherstnev V.V., Monakov A.M., Grebenshikova E.A., Kislyakova A.Yu., Yakovlev Yu.P., Krier A., Wright D.A. // Low Temperature Physics. 2007. V. 33. N 2–3. P. 283–290.
- [5] Именков А.Н., Шерстнев В.В., Сиповская М.А., Астахова А.П., Гребенщикова Е.А., Монахов А.М., Калинина К.В., Boissier G., Teissier R., Баранов А.Н., Яковлев Ю.П. // Письма в ЖТФ. 2009. Т. 35. В. 18. С. 50– 57.
- [6] Yarekha D.A., Glastre G., Perona A., Rouillard Y., Genty F., Skouri E.M., Bossier G., Grech P., Joullie A., Alibert C., Baranov A.N. // Electron. Lett. 2000. V. 36. N 6. P. 537–539.
- [7] Именков А.Н., Журтанов Б.Е., Астахова А.П., Калинина К.В., Михайлова М.П., Сиповская М.А., Стоянов Н.Д. // Письма в ЖТФ. 2009. Т. 35. В. 2. С. 29–35.
- [8] Данилова А.П., Данилова Т.Н., Именков А.Н., Колчанова Н.М., Степанов М.В., Шерстнев В.В., Яковлев Ю.П. // ФТП. 1999. Т. 35. В. 2. С. 243–248.